

맞춤형 Ptfе 웨이퍼 캐리어 세정 바스켓 내부식성 비침출 고분자 실험 지지대

품목 번호: PL-CP264



소개

반도체 및 고분자 연구용으로 설계된 고성능 맞춤형 PTFE 웨이퍼 캐리어 및 세정 바스켓입니다. 탁월한 내부식성과 제로 리칭(Zero-leaching) 특성을 갖춘 이 맞춤형 솔루션은 오늘날 고정밀 실험실 및 산업 응용 분야의 까다로운 화학 환경에서 오염 없는 프로세스를 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	핵심 이점
반도체 습식 에칭	산화물을 제거하거나 패턴을 정의하는 산 기반 에칭 공정 중 실리콘 웨이퍼 고정.	화학적 불활성으로 배스 오염 방지.
미량 금속 분석	환경 또는 지질학적 연구를 위해 고순도 산 배스에서 실험 기구 및 샘플 세정.	제로 금속 리칭으로 분석 정확도 보장.
고분자 합성	고온 용매 기반 반응에서 촉매 캐리어 또는 기판 지지.	높은 열 저항성 및 비점착 표면.
태양전지 제조	다단계 세정 및 텍스처링 배스를 통과하는 대형 실리콘 기판 운반.	대량 처리량을 위한 내구성 있는 구조.
제약 세정	공격적인 세제 용액에서 민감한 유리 또는 금속 부품 멸균 및 세정.	고순도 및 비오염 표준 준수.
전기화학 증착	부식성 전해질 용액에서 금속 도금 또는 증착 중 기판 고정.	전기 절연 및 화학적 안정성.
광전자 부품 처리	LED 및 레이저 다이오드 제조용 유리 또는 사파이어 기판 세정 및 핸들링.	스크래치 방지 핸들링 및 잔류물 없는 행균.
고온 건조	웨이퍼를 습식 배스에서 가열된 건조 챔버나 오븐으로 직접 이동.	260°C까지 구조적 무결성 유지.

특징	사양 세부 정보 (PL-CP264 시리즈)
제품 식별	PL-CP264 맞춤형 웨이퍼 캐리어
주요 재료	고순도 비진(100% Virgin) PTFE (PFA 선택 가능)
사용자 정의 상태	100% 맞춤형 / 주문 제작
온도 범위	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
화학적 상용성	범용 (모든 산, 염기, 용매, 용융 알칼리 금속 제외)
슬롯 구성	사용자 정의 가능 (너비, 피치, 각도 및 깊이)
웨이퍼 호환성	1", 2", 4", 6", 8", 12" 또는 비표준 형상의 맞춤 크기
제작 방법	고정밀 CNC 가공
표면 마감	매끄럽고, 마찰이 적으며, 다공성이 없음
핸들 옵션	통합형, 분리형 또는 로봇 인터페이스
배치 용량	사용자 사양에 따라 설계 (단일 또는 다중 웨이퍼)